PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

10-001643

(43) Date of publication of application: 06.01.1998

(51)Int.Cl.

CO9J 7/00 CO8G 59/56 C09J179/08 CO9J183/08

(21)Application number: 08-155312

(71)Applicant: SUMITOMO BAKELITE CO LTD

(22)Date of filing:

17.06.1996

(72)Inventor: YOSHIDA TATSUHIRO

(54) HEAT-RESISTANT FILM ADHESIVE AND ITS PRODUCTION

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain an adhesive that has high thermal resistance together with high workability and is suitable for a semiconductor mounting material by compounding a specific polyimide resin. epoxy compound, specific multifunctional amino compound and silane compound at specific rates of them.

SOLUTION: This adhesive, which has excellent adhesivity to silicon substrates and metals for electronic applications, comprises (A) 100 pts.wt. of a polyimide resin containing 5-50mol% of a silane compound of formula I (R1 and R2 are each a divalent 1-4C aliphatic or aromatic group; R3-R5 are each a monovalent aliphatic or aromatic group; k is 1-20) which is soluble in organic solvents and has a glass transition temperature of 350° C or below, (B) 5-100 pts.wt. of an epoxy compound having at least two epoxy groups in a molecule, (C) 0.1-20 pts.wt. of a multifunctional amino compound of formula II [(n) is 210], and (D) 0.1-20 pts.wt. of a silane coupling agent.

$$\begin{array}{c|c} \mathbf{NH_2-R_1} & \mathbf{R_3} & \mathbf{R_3} \\ \mathbf{NH_2-R_1} & \mathbf{SI-O} & \mathbf{SI-R_2-NH_2} \\ \mathbf{R_4} & \mathbf{k} & \mathbf{R_3} \end{array}$$

- 11

Ľ

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

06.02.2003

[Date of sending the examiner's decision of

rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

3695848

[Date of registration]

08.07.2005

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's . decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(19)日本国特許庁(JP)

(12)公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平10-1643

(43)公開日 平成10年(1998)1月6日

(51) Int. Cl. ° CO9J 7/00 CO8G 59/56 CO9J179/08 183/08	識別記号 JHL NJD JGE JGH	庁内整理番号	F 1 C09J 7/00 C08G 59/56 C09J179/08 183/08	JHL NJD JGE JGH	技術表示箇所	
	·		審査請求	· 未請求 請求項の数 7	OL (全9頁)	
(21)出願番号	特願平8-155	3 1 2	(71)出願人	000002141 住友ベークライト株式:	会社	
(22) 出願日	平成8年(199	6)6月17日	(72)発明者	東京都品川区東品川2丁目5番8号 吉田 達弘 東京都品川区東品川2丁目5番8号 住友 ベークライト株式会社内		

(54) 【発明の名称】耐熱性フィルム接着剤およびその製造方法

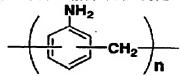
(57)【要約】

【課題】 マイクロエレクトロニクス材料、半導体実装材料として工業的に極めて利用価値が高い耐熱性と接着作業性を両立させた信頼性の高いフィルム接着剤を提供する。

【解決手段】 (A)有機溶剤に可溶で、ガラス転移温度が350℃以下のポリイミド樹脂 100重量部に対して、(B)1分子中に少なくとも2個のエポキシ基を有するエポキシ化合物5~100重量部、(C)多官能性アミノ化合物0.1~20重量部及び(D)シランカップリング剤を主たる成分とする耐熱性フィルム接着剤およびその製造方法。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 (A) 有機溶剤に可溶なガラス転移温度が350℃以下のポリイミド樹脂100重量部、(B) 1分子中に少なくとも2個のエポキシ基を有するエポキシ化合物5~100重量部、(C) 一般式(1) で表さ



(式中、nは2から10の整数)

【請求項2】 成分(A)が一般式(2)で表されるシロキサン化合物をアミン成分総置の5~50モル%含有

れる多官能性アミノ化合物 0.1~20 重量部及び (D)シランカップリング剤 0.1~20 重量部を主た る成分とする耐熱性フィルム接着剤。 【化1】

(1)

してなるポリイミド樹脂である請求項1記載の耐熱性フィルム接着剤。

【化2】

$$NH_2-R_1 \leftarrow \begin{pmatrix} R_3 & R_5 \\ SI-O & SI-R_2-NH_2 \\ R_4 & R_6 \end{pmatrix}$$
 (2)

(式中、RI,R2:2価の、炭素数1~4の脂肪族基または芳香族基

R3, R4, R5, R6: 1 価の脂肪族基または芳香族基

k:1~20の整数)

(式中、Yはアミノ基を有する有機基 P'は炭素数 1~4 の 2 価の炭化水素基 P'は炭素数 1~4 のアルキル基 P'は炭素数 1~4 のアルキル基 mは 1~3 の整数を表す。)

【請求項4】 (A) 有機溶剤に可溶なガラス転移温度が350℃以下のポリイミド樹脂100重量部、(B) 1分子中に少なくとも2個のエポキシ基を有するエポキシ化合物5~100重量部、(C) 一般式(1) で表される多官能性アミノ化合物0.1~20重量部及び

(D)シランカップリング剤 0.1~20重量部を主たる成分とする樹脂組成物を、支持体の片面又は両面に流延成形する耐熱性フィルム接着剤の製造方法。

【請求項5】 (A) 有機溶剤に可溶なガラス転移温度が350℃以下のポリイミド樹脂100重量部、(B) 1分子中に少なくとも2個のエポキシ基を有するエポキシ化合物5~100重量部、(C) 一般式(1) で表される多官能性アミノ化合物0.1~20重量部及び

(D) シランカップリング剤 0. 1~20重量部を主たる成分とする樹脂組成物を、支持体の上に流延成形後、乾燥後、支持体から剥離して得る耐熱性フィルム接着剤の製造方法。

【請求項6】 成分(A)が一般式(2)で表されるシロキサン化合物をアミン成分総置の5~50モル%含有してなるポリイミド樹脂である請求項4又は5記載の耐熱性フィルム接着剤の製造方法。

【請求項7】 シランカップリング剤が一般式(3)で 50 る。

20 ム接着剤。

[化3]

【請求項3】

(3)

表されることを特徴とする請求項4又は5記載の耐熱性フィルム接着剤の製造方法。

表されることを特徴とする請求項1記載の耐熱性フィル

シランカップリング剤が一般式(3)で

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、耐熱性と加工性を併せもち、エレクトロニクス用途、特に半導体実装材料として適したシリコン基板や金属に対する接着力に優れたフィルム接着剤と、その製造方法に関するものである。

[0002]

40

【従来の技術】近年、半導体チップが高機能大容量化に よって大型化する一方、パッケージの大きさはプリント 回路設計上の制約、電子機器小型化の要求などから従来 と変わらない、あるいはむしろ小さな外形を要求されて いる。この傾向に対応して、半導体チップの高密度化と 高密度実装に対応した新しい実装方式が幾つか提案され ている。一つはメモリー素子に提案されているダイ・パ ッドのないリードフレームの上にチップを載せるCOL (チップ・オン・リード) 構造と、その発展形であるチ ップの上にリードを載せるLOC(リード・オン・チッ プ) 構造である。一方、論理素子には電源、グランドを 別フレームにし、さらに放熱のための金属プレートを多 層化した多層リードフレーム構造がある。これらによる とチップ内配線やワイヤー・ポンディングの合理化、配 線短縮による信号高速化、消費電力の増大に伴って発生 する熱の放散等と素子サイズの小型化を図ることができ

【0003】この新しい実装形態では、半導体チップとリードフレーム、リードフレームとプレート、リードフレーム同士など同種異種材質の接着界面が存在し、その接着信頼性が素子の信頼性に非常に大きな影響を与える。素子組立作業時の工程温度に耐える信頼性は勿論のこと、吸湿時、湿熱時などの接着信頼性である。さらに接着作業性も重要な項目である。

【0004】従来、これらの接着にはペースト状の接着 剤や耐熱性基材に接着剤を塗布したものが使用されてい た。エポキシ樹脂系、アクリル樹脂系、ゴムーフェノー ル樹脂系の熱硬化性樹脂が接着剤として使用されている が、イオン性不純物が多い、加熱硬化に高温長時間を必 要とし生産性が悪い、加熱硬化時に多量の揮発分が発生 しリードを汚染する、吸湿性が高い、など高信頼性接着 剤としての要求を満たしているとは言い難く、満足でき る材料が見当らない。新しい実装形態に適した接着剤の 開発が求められている。その一つの方法としてポリイミ ド樹脂を用いたホットメルト型のフィルム接着剤が挙げ られる (特開平5-105850, 112760, 112761号 公報参 照)。ホットメルトタイプの接着剤であれば、短時間に 被着体に熱圧着することが可能であり、接着後の加熱硬 化工程が必要ではなくなり、生産性、信頼性の向上に大 きく寄与すると考えられる。しかしながら、ホットメル ト型であるがため接着剤樹脂のガラス転移温度が高いと

(式中、nは2から10の整数)

【0008】本発明の接着剤樹脂の必須成分である成分(A)ポリイミド樹脂は、3,3',4,4'ーピフェニルテトラカルポン酸二無水物、3,3',4,4'ーペンゾフェノンテトラカルポン酸二無水物、4,4'ーオキシジフタル酸二無水物およびエチレングリコール・ストリメリット酸二無水物、無水ピロメリット酸からなる群より選ばれた1種または2種以上のテトラカルポン酸二無水物と芳香族ジアミンとを重合させることにより得られたものであることが好ましい。前記ポリイミドの製造に用いられる芳香族ジアミンとして、例えば、2,2ーピス(4ー(4ーアミノフェノキシ)フェニル)プロパン、1,3ーピス(3ーアミノフェノキシ)ベンゼ

加工に非常に高温を要し、被着材に熱損傷を与える恐れが大きい。一方、低温加工性を付与するためガラス転移 温度を下げると耐熱性が下がり、よって信頼性が低下す るという問題点があった。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、低温での加工性に優れた耐熱性フィルム接着剤を得るべく鋭意研究を重ねた結果、特定構造のポリイミド樹脂にエポキシ化合物および該エポキシ化合物と反応可能な活性水素基を有する多官能性アミノ化合物、およびシランカップリング剤を添加すると、上記課題を解決することができることを見出し、本発明に到達したものである。

[0006]

【課題を解決するための手段】本発明は、ガラス転移温度が350℃以下の有機溶剤に可溶なポリイミド樹脂100重量部に対して、1分子中に少なくとも2個のエポキシ基を有するエポキシ化合物5~100重量部、該エポキシ化合物と反応可能な活性水素基を有する一般式(1)で表される多官能性アミノ化合物0.1~20重量部、シランカップリング剤0.1~20重量部を主たる接着剤樹脂成分とする耐熱性フィルム接着剤およびそ

[0007]

の製造方法に関する。

【化1】

(1)

30 ン、2,2-ビス(4-(4-アミノフェノキシ)フェニル)へキサフルオロプロパン、2,2-ビス(4-アミノフェノキシ)へキサフルオロプロパン、ビスー4ー(4-アミノフェノキシ)フェニルスルフォン、ビスー4ー(3-アミノフェノキシ)フェニルスルフォンなどを挙げることができ、それらを単独、あるいは併用して使用することができる。また前記ポリイミドのジアミン成分の一成分として式(2)で表されるシロキサン化合物をジアミン成分総量の5~50モル%用いることがより好ましい。

40 [0009] [4:2]

$$NH_2-R_1 \leftarrow \begin{pmatrix} R_3 & R_5 \\ SI-O \end{pmatrix} - SI-R_2-NH_2$$

$$k R_6$$
(2)

(式中、RI,R2:2価の、炭素数1~4の脂肪族基または芳香族基

R3, R4, R5, R6: 1 価の脂肪族基または芳香族基k: 1~20の整数)

【0010】式(2)で表されるシロキサン化合物が、ジアミン成分の総量の5モル%より少ないと得られるポリイミドの有機溶剤への溶解性が低下し、50モル%を越 50 えるとガラス転移温度が著しく低下し耐熱性に問題が生 5

じる。さらに、一般式(2)で表されるシロキサン化合物として具体的には、下記一般式(4)で表される α , ω -ビス(3-アミノプロピル)ポリジメチルシロキサン(APPS)が好ましく、特にkの値が $4\sim10$ の範囲が、ガラス転移温度、接着性、耐熱性の点から好ましい。これらのシロキサン化合物は単独で用いることは勿

論、2種類以上を併用することもできる。特にk=1と、上記 $k=4\sim10$ のものをプレンドして用いることは、接着性を重視する用途では好ましい。

[0011]

【化4】

$$NH_2 - (CH_2)_3 - \left(\begin{array}{c} CH_3 \\ SI - O \\ CH_3 \end{array}\right) + \begin{array}{c} CH_3 \\ SI - (CH_2)_3 - NH_2 \\ CH_3 \end{array}$$

(式中、k:1~20の整数)

【0012】 重縮合反応における酸成分とアミン成分の 当量比は、得られるポリアミック酸の分子量を決定する 重要な因子である。ポリマの分子量と物性、特に数平均 分子量と機械的性質の間に相関があることは良く知られ ている。数平均分子量が大きいほど機械的性質が優れて いる。従って、実用的に優れた強度を得るためには、あ る程度高分子量であることが必要である。本発明では、 酸成分とアミン成分の当量比 r が

 $0.900 \le r \le 1.060$

より好ましくは

 $0.975 \le r \le 1.025$

の範囲にあることが好ましい。ただし、 r = [全酸成分の当量数] / [全アミン成分の当量数] である。 r が0.900未満では、分子量が低くて脆くなるため接着力が弱くなる。また1.06を越えると、未反応のカルポン酸が加熱時に脱炭酸してガス発生、発泡の原因となり好ましくないことがある。本発明のポリイミド樹脂の分子量制御のため、ジカルポン酸無水物あるいはモノアミンを添加することは、上述の酸/アミン モル比の範囲であれば特にこれを妨げない。

【0013】テトラカルポン酸二無水物とジアミンとの 反応は、非プロトン性極性溶媒中で公知の方法で行われ る。非プロトン性極性溶媒は、N、N-ジメチルホルム アミド (DMF)、N、N-ジメチルアセトアミド (D MAC) 、N-メチル-2-ピロリドン (NMP) 、テ トラヒドロフラン(THF)、ジグライム、シクロヘキ サノン、1, 4-ジオキサン(1, 4-DO)などであ る。非プロトン性極性溶媒は、一種類のみ用いてもよい し、二種類以上を混合して用いてもよい。この時、上記 非プロトン性極性溶媒と相溶性がある非極性溶媒を混合 して使用しても良い。トルエン、キシレン、ソルベント ナフサなどの芳香族炭化水素が良く使用される。混合溶 媒における非極性溶媒の割合は、30重量%以下である ことが好ましい。これは非極性溶媒が30重量%以上で は溶媒の溶解力が低下しポリアミック酸が析出する恐れ があるためである。テトラカルポン酸二無水物とジアミ ンとの反応は、良く乾燥したジアミン成分を脱水精製し た前述反応溶媒に溶解し、これに閉環率98%、より好 ましくは99%以上の良く乾燥したテトラカルポン酸二 無水物を添加して反応を進める。

【0014】このようにして得たポリアミック酸溶液 を、続いて有機溶剤中で加熱脱水環化してイミド化しポ リイミドにする。イミド化反応によって生じた水は閉環 反応を妨害するため、水と相溶しない有機溶剤を系中に 加えて共沸させてディーン・スターク (Dean-Stark) 管 などの装置を使用して系外に排出する。水と相溶しない 有機溶剤としてはジクロルベンゼンが知られているが、 エレクトロニクス用としては塩素成分が混入する恐れが 20 あるので、好ましくは前記芳香族炭化水素を使用する。 また、イミド化反応の触媒として無水酢酸、β-ピコリ ン、ピリジンなどの化合物を使用することは妨げない。 【0015】本発明において、イミド閉環は程度が高い ほど良く、イミド化率が低いと使用時の熱でイミド化が 起こり水が発生して好ましくないため、95%以上、よ り好ましくは98%以上のイミド化率が達成されている ことが望ましい。

【0016】本発明では、得られたポリイミド溶液にそ のままエポキシ化合物や該エポキシ化合物と反応可能な 活性水素基を有する多官能性アミノ化合物およびシラン カップリング剤を添加し、樹脂ワニスを調整し支持体に 塗布しても良いが、該ポリイミド溶液を貧溶媒中に投入 してポリイミド樹脂を再沈析出させて未反応モノマを取 り除いて精製することが好ましい。精製、乾燥したポリ イミド樹脂およびエポキシ化合物や該エポキシ化合物と 反応可能な活性水素基を有する化合物およびカップリン グ剤を有機溶剤に溶解して塗布ワニスとする。この時使 用する溶剤は反応溶媒と同じでも良いが、塗布乾燥工程 の作業性を考え沸点の低い、好ましくは沸点が200℃ 40 以下の溶剤を選択することが好ましい。200℃以下の 溶剤として、本発明ではケトン系溶剤として、アセト ン、メチルエチルケトン、メチルイソプチルケトン、シ クロペンタノン、シクロヘキサノンを、エーテル系溶剤 として、1,4-ジオキサン、テトラヒドロフラン、ジグラ イムを、アミド系溶剤として、N,N-ジメチルホルムアミ ド、N.N-ジメチルアセトアミドを挙げることができる。 これらの溶剤は単独で使用しても良いし、2種以上を混 合して用いることもできる。

【0017】本発明の接着剤樹脂において使用する成分 (B) エポキシ化合物は、少なくとも1分子中に2個の

50

R

エポキシ基を有するものであれば特に限定されるものではないが、ポリイミド樹脂の溶媒への溶解性が良好なものが好ましい。例えば、ビスフェノールA型のジグリシジルエーテル、ピスフェノールF型のジグリシジルエテル、フェノール/ボラック型エポキシ樹脂、ピフェノールP型のジグリンエール型エポキシ樹脂等が挙げられる。前記エポキシ樹脂等が挙げられる。前記エポキシ樹脂 100重量部の範囲に対して5~100重量部、特に10~70重量部の範囲にあることが好ましい。5重量部未満では、未硬化のエポキシ化合物を添加し、樹脂組成物の軟化温度を下げ低温をという効果が現れにくく、100重量部をこえるとポリイミド樹脂の耐熱性を損なうこととなり好ましくない。

【0018】本発明の接着剤樹脂において使用する成分(C) 該エポキシ化合物と反応可能な活性水素基を有する多官能性アミノ化合物は、成分(A)のポリイミド樹脂や成分(B)のエポキシ樹脂との相溶性、ポリイミド樹脂の溶媒への溶解性が良好なものが好ましい。具体的にはアニリン樹脂が挙げられる。成分(C)の配合割合は成分(A)のポリイミド樹脂100重量部に対して0.1~20重量部、より好ましくは0.5~10重量

Y-P1-SiP23-m(OP3)m

(式中、Yはアミノ基を有する有機基 P'は炭素数 1~4の2 価の炭化水素基 P'は炭素数 1~4のアルキル基 P'は炭素数 1~4のアルキル基 mは1~3の整数を表す。)

【0021】具体例としては、ビニルトリメトキシシラ ン、ビニルトリエトキシシラン、ビニルトリス (βメト キシエトキシ) シラン、ァーグリシドキシプロピルトリ メトキシシラン、ァーグリシドキシプロピルメチルジェ トキシシラン、β – (3, 4 エポキシシクロヘキシル) エチルトリメトキシシラン、ァーアミノプロピルトリエ トキシシラン、N-フェニルーィーアミノプロピルトリ メトキシシラン、N-β (アミノエチル) $\gamma-$ アミノプ ロピルトリメトキシシラン 、N - β (アミノエチル) ァーアミノプロピルメチルジメトキシシランなどを挙げ ることができ、これらは併用することもできる。シラン カップリング剤の配合割合は成分(A)のポリイミド樹 脂100重量部に対して0、1~20重量部、より好ま しくは0.5~10重量部である。0.1重量部未満で は、当該樹脂組成物を接着用途に用いる場合、被着材と の密着性を向上させる効果が現れない。20重量部をこ えると樹脂組成物のライフが短くなり加工性が低下する 場合があり、また樹脂組成物の耐熱性を損ない、好まし くない。

【0022】本発明の耐熱性樹脂組成物にはその加工性、耐熱性を損なわない範囲で微細な無機充填材が配合されていても良い。樹脂ワニスには表面平滑性を出すた 50

部である。 0. 1 重量部未満では、エポキシ化合物の反応率が極端に低くなり本発明にて望まれる効果が現れない。高温時の樹脂の弾性率が低下している時の樹脂フローの制御が困難である。 2 0 重量部を越えると樹脂溶散状態でゲルが生じやすくなり、加工性が損なわれ、また樹脂組成物の耐熱性を損ない好ましくない。 さらにアニリン樹脂に求められる特性として軟化点が 6 0 ~1 2 0 ℃であることがより好ましい。軟化点が 1 2 0 ℃以上では成形加工温度を下げることができず、 6 0 ℃以下では加工温度を下げることはできても成形物の耐熱性が著しく低下する場合が生じ好ましくない。

【0019】また本発明の耐熱性樹脂組成物において使用する成分(D)シランカップリング剤は、成分(A)や成分(B)、(C)との相溶性、ポリイミド樹脂の溶媒への溶解性が良好なものが好ましく、特にビニルシラン、エポキシシラン、アミノシラン等が好適に挙げられる。中でも特に一般式(3)で表されるカップリング剤(アミノ系シラン)が好ましい。

[0020]

20 【化3】

(3)

めの平滑剤、レベリング剤、脱泡剤などの各種添加剤を必要に応じて添加することができる。また、溶剤の蒸発速度を調節するために均一に溶解する範囲で芳香族炭化水素溶剤を使用することもできる。本発明において樹脂ワニスをフィルム接着剤とするには、樹脂ワニスを放びできるには、樹脂ワニスを放びできるには、樹脂ワニスを放びできる。本発明において樹脂ワニスを力に、例えば耐熱性フィルム接着剤として別ないの方法で得ることができる。

【0023】本発明において使用する耐熱性フィルム基材は、ポリイミド樹脂フィルムが熱膨張係数が小さく温度変化に対する寸法安定性に優れていること、可撓性に富み取り扱い易いこと、本発明の樹脂との密着力が以上の電み取り扱い易いこと、本発明の樹脂との密着力が以上のポリイミド樹脂は、塗布ワニスを乾燥する工程でのの塗布といる。樹脂ワニスを変化であることができる。樹脂ワニスを支持体に塗工後、熱風気燥炉を組み合わせた装置などを用め気燥ができり、温度と風景でもできる。樹脂ワニスを支持体に塗工後、熱風気燥ができって、の溶剤を揮散させるに十分な温度と風景でもに強する。本発明のフィルム接着剤の使用方法は特にしたといる。本発明のフィルム接着剤の使用方法は特にしたといて、対ロックで熱圧着するなど、接着テープも0として使用することができる。

10

【0024】本発明のフィルム接着剤は、有機溶剤に可 溶なガラス転移温度が350℃以下のポリイミド樹脂1 00重量部に対して、1分子中に少なくとも2個のエポ キシ基を有するエポキシ化合物5~100重量部、多官 能性アミノ化合物 0. 1~20 重量部、シランカップリ ング剤 0.1~20 重量部を主たる樹脂成分として含有 されていることを特徴とする。この樹脂の見かけ上のガ ラス転移温度は、主成分のポリイミド樹脂のガラス転移 温度より低下し低温加工性が向上する。一方、ガラス転 移温度より高温域での接着力は該ポリイミド樹脂より向 上し、IRリフローなどの熱衝撃を与えても剥離が認め られないなどの、高温域での物性が向上する。この特異 な現象に対する詳細な機構は未だ明らかではない部分も あるが、エポキシ化合物と該エポキシ化合物と反応可能 な活性水素基を有する多官能性アミノ化合物が反応した 低分子量の生成物は、特定構造のポリイミド樹脂に対し て可塑剤として作用し、該ポリイミド樹脂のガラス転移 温度より低温域での弾性率を低下せしめ、よって接着 性、加工性など低温での作業性の向上をもたらす。一 方、ガラス転移温度より高温域では、その与えられた熱 によって三次元網目構造が形成され、ポリイミド樹脂の 流動性を低下せしめ、よって該ポリイミド樹脂の耐熱性 を維持あるいは向上せしめると考えられる。以上の機構 によって低温加工性と高温時の耐熱信頼性の両立がはか られる。また、化学反応を伴う熱硬化性接着剤に比べる と極めて短時間に接着可能である。テープ状に加工する ことにより、接着作業性、接着部の寸法精度を優れたも のにすることができる。以下実施例により本発明を詳細 に説明するが、これらの実施例に限定されるものではな

[0025]

【実施例】

(ポリイミド樹脂PI-1の合成) 乾燥窒素ガス導入管、冷却器、温度計、撹拌機を備えた四ロフラスコに、脱水精製したNMP791gを入れ、窒素ガスを流しながら10分間激しくかき混ぜる。次に2,2-ピス(4-(4-アミノフェノキシ)フェニル)プロパン(BAPP)73.8926g(0.180モル)、1,3-

【0026】その後、窒素ガス導入管と冷却器を外し、キシレンを満たしたディーン・スターク管をフラスコに装着し、系にキシレン198gを添加した。油浴に代えて系を 175℃に加熱し発生する水を系外に除いた。4時間加熱したところ、系からの水の発生は認められなくなった。冷却後この反応溶液を大量のメタノール中に投入し、ポリイミド樹脂を析出させた。固形分を適の20後、80℃で12時間減圧乾燥し溶剤を除き、227、79g(収率92.1%)の固形樹脂を得た。KBr錠剤法で赤外吸収スペクトルを測定したところ、環状イミド結合に由来する5.6μmの吸収を認めたが、アミド結合に由来する6.06μmの吸収を認めることはできず、この樹脂はほぼ100%イミド化していることが確かめられた。

【0027】このようにして得たポリイミド樹脂は、ガラス転移温度が148 $\mathbb C$ 、引っ張り弾性率が180 kg f $/mm^1$ 、ジメチルホルムアミド (DMF)、1, 4-30 ジオキサン (1, 4-DO) に良く溶解することが確かめられた。

【0028】(ポリイミド樹脂 P I - 2 および P I - 3 の合成)前記のポリイミド樹脂 P I - 1 の合成と同様にして、P I - 2 および P I - 3 を得た。得られたポリイミド樹脂 P I - 1、P I - 2 および P I - 3 の物性を表1に示した。

[0029]

【表1】

12

11 第1数

珥 Ħ PI-IP I - 2 P I - 3 50 BPDA 6 0 9 0 酸成分 BTDA 4 0 ODPA (モル比) 70 ___ TMEG 5 0 配合 BAPP B 0 2 0 6 5 APB アミン成分 20 5 5 (モル比) DPX 2 0 APPS 20 2 3 1 5 APDS 2 政/アミン当 放比 0 0 r 1. 0 0 ì. 0 0 s DMF 5 9 幕 解 性 のは搭載に格解 ることを示す) S 1,4-D O S s тнг s s S ガラス転移温度 (°C) 1 4 8 183 7 6 引張り弾性率 (kgf/no*) 180 170 2 1 9 6. D2 5. 8 1 伸び率 (%) 5. 94 5. 3 3 引張り強さ (kgf/mm²) 5. 1 S 6. 8 2 ヤング坐 @ 3 0 °C . GPa 2. 05 1. 58 ī... 9 4 @ 2 5 0 °C MP a < 0.5 < 0. 5 0. 8.0

【0030】配合の欄のBTDA、ODPA、DPXは3,3',4,4'ーペンゾフェノンテトラカルボン酸二無水物、4,4'ーオキシジフタル酸二無水物、2,5ージメチルーpーフェニレンジアミンをそれぞれ表し、APDSは1,3ーピス(3ーアミノプロピル)テトラメチルジシロキサン(式(2)においてk=1)を表す。溶解性の欄のSは該当する溶媒に溶解することを示す。ガラス転移温度はDSC測定により求めた。引張り試験は室温、引張り速度5mm/minにて測定した。ヤング率は粘弾性スペクトロメーターにより求めた。

【0031】 (実施例1)

【0032】 (耐熱性フィルム接着剤の製造) 前記のワ

二スをリバースロールコーターでポリイミドフィルム (商品名ユーピレックスSGA、厚み50μm、宇部興 産(株)製)の片面に塗布し、接着剤層の厚みが30μm の接着テープを得た。乾燥温度は最高195℃で乾燥時間20分であった。このフィルム接着剤を42アロイプレートに熱圧着して試験片を作製し(250℃2秒間熱 圧着し、圧を解放後250℃で30秒間 アニールした。接着面にかかる圧力はゲージ圧力と接着面積から計算の 結果4kgſ/cm'であった。)、テンシロンにて180度 ピール強度を測定した結果を表2に示す。接着強度は常態およびプレッシャークッカー(125℃、48時間、飽和100%)で処理した後の室温での180度ピール 30 強度を測定したものである(引張り速度50mm/min)。試験片の破断面は接着樹脂層が凝集破壊し、発泡は全く認められなかった。

【0033】(実施例2)前記のワニスをリバースロールコーターで二軸延伸ポリエステルフィルム(商品名ダイヤホイル、厚さ50μm、ダイアホイルヘキスト(株)製)に塗布し、乾燥後ポリエステルフィルムから剥離し、30μm厚みの支持体なしの均一な単層フィルム接着剤を得た。剥離は容易で特に支障はなかった。実施例1と同様に42アロイのプレートに接着した結果を表2に40示す。

【0034】(実施例3~5)実施例1および2と同様にして、表2に示す配合にて塗布ワニスを調整しフィルム接着剤を得た。得られた評価結果を表2に示す。

[0035]

【表2】

配名	}		実施例 1	实施例 2	実施例3	実施例 4	実施例 5
1	A)成分	(#1)	P1-1	1	P1-1	PI 2	P1-8
L	配合	量·g	100	1	100	100	100
(B)成分	(\$2)	11. J-1856		YX-4000H	EOCN-1020	It'3-1828
	165	9 量合	40		20	50	20
(C)成分	(*3)	PR-AF-S		PR-AF-S	PR-AF-S	PR-AF-S
	B2 ·	<u>企量 g</u>	5.0		10	5.0	1.0
C	D)成分	(*4)	EBC1003		KBE1003	KB# 573	EBN578
	配:	e 量 g	5.0		10	5.0	1.0
特性							
粹	1	DMF	S	Λ	s	S	S
解	1.4	- D O	S		Ş	S	S
樵		THF	,S		S	S	S
ガラス転移温度 ℃		135		140	131	154	
킯	弹性 2	Kagf/oom²	173		189	164	192
引張り特性	伸び	%	5.43		4.98	5.24	6-03
佳	強き	kg [/on²	5.62		5.05	5.47	5.15
ヤン	グ卒	930C GPa	1.84		2.01	1.77	1.53
		8250CNPa	2.12		2.85	2.51	2.34
フィルム接着剤							
	塗布 3		ューヒンレックス	ታ 1 ተቀ ተ ተ	コーヒーレックス	コーヒ・レッタス	9"17#18
4270	4 LD		1.87	1.13*	1.83	1-89	1.10*
"kg"f	Tun	PCARRORT	1 - 54	1.054	1.36	1.32	1.12*
		PC集理整理24Dで	0.93	0.76*	0.82	0-90	0.78*

{*})スプルム按着創歌野島の接着強度を示す。

(*2)成分(B):エポキシ化合物

(*3)成分 (C): 多官能性アミノ化合物 (*4)成分 (D): シランカップリング制

【0036】溶解性の欄のSは、該当する溶媒に溶解することを示す。ガラス転移温度はDSC測定により求めた。引張り試験は室温、引張り速度5 /minにて測定した。ヤング率は粘弾性スペクトロメーターにより求めた。使用する成分(B) エポキシ化合物について、エピコート828はピスフェノールA型エポキシ化合物、油化シェルエポキシ(株) 製、YX-4000Hはピフェニル型エポキシ化合物エピコートYX-4000H、油化シェルエポキシ(株) 製、EOCN-1020はクレゾールノボラック型エポキシ樹脂、日本化薬(株)をそれぞれ示している。使用する成分(D) カップリング剤はКВС1003(トリスメトキシエトキシピニルシラ 40

ン)、、KBE1003 (トリエトキシビニルシラン)、KBM573 (N-フェニルーァーアミノプロピルトリメトキシシラン) 信越化学 (株) 製を使用した。【0037】 (比較例1、2および3) ポリイミド樹脂のみの樹脂組成物あるいは成分 (B) ~ (D) のうちで一種または二種加えた樹脂組成物を調整し、ポリイミドフィルム (ユーピレックス) の片面に塗布し、フィルム接着剤を得た。42アロイプレートとの接着強度を実施例と同様にして測定し、その結果を表3に示した。

[0038]

【表3】

第9表

配合		比較例 1	比較例 2	比較例3
(A)成分	(*1)	PI-I	PI-3	PI-1
配合量 g (B)成分 (*2)		100	100	100
		-	-	zt* 1-1828
E2 4	g 最信	-	_	20
(C)成分	(*3)		PR-AF-S	_
PL &	5 ⊈ g	-	10	_
(D)成分	(*4)	_	KBN 573	
配台	a de de la company de la comp	_	5.0	1
42704 との 接着強度 kg f/cm	常思	1.98	1.62	2.05
kg f/cm	PCAREORT	0.72	0.83	0.51
	PC% F 6240T	0.24	< 0.1	0.26

(*1)成分 (A):ポリイミド樹脂 (*2)成分(B):エポキシ化合物

(*3)成分 (C):多官能性アミノ化合物 (*4)成分(D):シランカッリプリング剤

【0039】表2、3の結果から、実施例のフィルム接 . 着剤の接着強度は吸湿加熱後でもその強度はわずかしか と比べて低下するものの、比較例のそれと比べて強度が 大きく低下することを防ぐことが可能である。以上のこ とから本発明により、吸熱時の接着強度が大きく低下す ることを防ぎ、耐熱性と成形加工性に優れたフィルム接 **着剤を得られることが示される。**

[0040]

【発明の効果】本発明によれば、耐熱性と成形加工性を

両立させた信頼性の高いフィルム接着剤を提供すること が可能である。低沸点溶媒に可溶であるため残留溶媒を 低下していない。、また吸湿後熱時の接着強度は、常態 20 ほぼ完璧になくすことが可能で、また既にイミド化され ているため、加工時にイミド化のための高温過程が不要 で水分の発生も無い。またタックのないフィルムとして 使用することができるので連続作業性やクリーンな環境 を必要とする場合に非常に有効である。このため高信頼 性と耐熱性を要求するエレクトロニクス用材料としてエ 業的に極めて利用価値が高い。